

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 17 年 11 月 17 日 (2005.11.17)

【公表番号】特表 2005-516099 (P2005-516099A)

【公表日】平成 17 年 6 月 2 日 (2005.6.2)

【年通号数】公開・登録公報 2005-021

【出願番号】特願 2003-564132 (P2003-564132)

【国際特許分類第 7 版】

C 0 8 L 23/00

B 3 2 B 27/30

// (C 0 8 L 23/00

C 0 8 L 53:02)

【F I】

C 0 8 L 23/00

B 3 2 B 27/30 B

C 0 8 L 23/00

C 0 8 L 53:02

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 4 月 1 日 (2004.4.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

一般式： $S - EB - S(1)$ または $(S - EB)_n X(2)$

[式中、S はそれぞれ独立して主にスチレンのポリマーブロックであり、EB は主にブタジエンの水素化ポリマーブロックであり、n は 2 以上の整数であり、X はカップリング剤の残基である]

によって表される分子構造を有し、10～29wt%、好ましくは 17～24wt% の範囲内のポリスチレン含有量を有し、見掛け分子量が 6,000～9,000 の範囲内のポリスチレンブロック (S) を有し、ポリブタジエンブロック (EB) の前駆体中に 60～80% (モル/モル) の範囲の 1,2-付加率 (ビニル含有量) がある見掛け分子量が 80,000～150,000 の範囲内の完全ブロック共重合体を有し、この場合、前記ブロック EB が少なくとも 80%、好ましくは少なくとも 90% の水素添加率を有し、ジブロック S-EB が最高 20 モル%、好ましくは最高 10 モル% の含有量で場合によっては生じる、5～40wt% のスチレン系ブロック共重合体と、

少なくとも 40wt% 量のポリオレフィンと、

場合によっては、水素化ポリブタジエンブロックと相溶性である 0～25wt% 量の樹脂と

を含む (上記では、重量パーセントはすべて、完全な組成物の重量を基準とする)、食品包装用途用の単層フィルムまたは多層フィルムの製造に用いる組成物。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の組成物をベースとした少なくとも 1 つの層を含む単層フィルムまたは多層フィルム。

【請求項 3】

i. ポリスチレン含有量 (PSC) が 17～24wt% であり、

i i . スチレン系ブロック共重合体が、一般式： $S - EB - S(1)$ または $(S - EB)_n X(2)$ [式中、 S はそれぞれ独立してスチレンのポリマーブロックであり、 EB はブタジエンの水素化ポリマーブロックであり、 n は2以上の整数であり、 X はカップリング剤の残基である] で表される分子構造を有し、

i i i . ポリスチレンブロック (S) の見掛け分子量が $7,500 \sim 8,500$ の範囲内であり、

i v . 完全スチレン系ブロック共重合体の見掛け分子量が $80,000 \sim 150,000$ の範囲内であり、

v . ポリブタジエンブロック (EB) の前駆体中の 1, 2 付加率 (ビニル含有量) が $60 \sim 80$ (モル / モル) の範囲内であり、

v i . ブロック EB が少なくとも 80% 、好ましくは少なくとも 90% の水素添加を有し、

v i i . ジブロック $S - EB$ の含有量が、全ブロック共重合体量を基準として、場合により、最高 20 モル %、好ましくは最高 10 モル % である
スチレン系ブロック共重合体。